

7.4 著書

2003 年

1. 森田瑞穂: 赤外線加熱工学ハンドブック第Ⅲ章 1.1『極薄シリコン酸化膜形成への応用』, アグネ技術センター
2. 桑原裕司, 青野正和: ナノテクノロジー大辞典 監修: 川合知二, 工学調査会 2003 共著
3. 桑原裕司: 固体表面に組み込む, 先端化学シリーズVI 日本化学会編 2004 年 3 月 25 日発行 pp178-183
4. Y. Mori, K. Yamauchi, K. Hirose, K. Sugiyama, K. Inagaki, H. Mimura: Crystal Growth Technology edited by H. J. Scheel and T. Fukuda (2003) "Numerically Controlled EEM (Elastic Emission Machining) System for Ultraprecision Figuring and Smoothing of Aspherical Surfaces", John Wiley & Sons, Ltd.
5. Y. Mori, H. Kakiuchi, K. Yoshii and K. Yasutake: Crystal Growth Technology edited by H. J. Scheel and T. Fukuda (2003) 645-652. "High-Rate Deposition of Amorphous Silicon Films by Atmospheric Pressure Plasma Chemical Vapor Deposition", John Wiley & Sons, Ltd.
6. 森勇藏, 山内和人: “原子レベルの平滑面の創成(第 I 編, 第 4 章, 第 7 節) ナノテクノロジーハンドブック, 難波 進他 12 名編, オーム社
7. 森勇藏, 山村和也, 佐野泰久: 加工技術データファイル 基礎編(特殊加工) 5.7 プラズマ CVM, (財)機械振興協会 技術研究所

2004 年

1. K. Hirose, T. Ono, Y. Fujimoto and S. Tsukamoto: First-Principles Calculations in Real-Space Formalism - Electronic Configurations and Transport Properties of Nanostructures -, Imperial College Press, London, (2005).

2005 年

1. A. Saito: Reproduction of Morpho-Blue by Artificial Substrate, Structural Colors in Biological Systems Chapter VII Applications of Structural Colors (Osaka University Press) P287-295 August, 2005
2. 広瀬喜久治, 小野倫也: 計算機マテリアルデザイン入門 Introduction to Computational Materials Design -From the Basics to Actual Applications-, <基礎編> 第 10 章: RSPACE-04 -ナノ構造体の電気伝導特性- (pp.176-190) および <応用編> 第 10 章: RSPACE-04 (pp.368-377), 笠井秀明, 赤井久純, 吉田博 編, 大阪大学出版会 (2005).
3. Y. Fujimoto and K. Hirose: First-Principles Theory for the Calculation of Electron-Transport Properties,

2006 年

1. 安武潔, 垣内弘章, 大参宏昌:「大気圧プラズマの生成制御と応用技術」第2章 第7節 大気圧プラズマ CVD による無機物膜堆積 (2006) pp.135-151., サイエンス&テクノロジー
2. 三村秀和, 山内和人, 森勇藏: Elastic Emission Machining 図解「砥粒加工技術のすべて」(砥粒加工学会編), 工業調査会
3. 山村和也, 佐野泰久, 森勇藏: 大気圧プラズマの生成制御と応用技術, 第13節 プラズマ CVM による超精密加工, サイエンス&テクノロジー

2007 年

1. 安武潔, 渡部平司, 大参宏昌, 垣内弘章:「システムオンパネルをめざした低温ポリシリコン薄膜トランジスタの開発(監修 浦岡行治)」第2編 第6章 Ge 核を用いた Si 薄膜の低温結晶化技術 pp.199-210., シーエムシー出版
2. 垣内弘章, 大参宏昌, 安武潔:「フィルムベースエレクトロニクスの最新要素技術」(仮題), 第4章 低温成膜およびデバイスプロセス技術「大気圧プラズマ CVD」, シーエムシー出版
3. 齋藤彰, 青野正和: 表面物性工学ハンドブック第2版(27.1 節トピックス: STM による元素分析, 丸善 Jan, 2007 pp.961-961 の開発, 日本中性子科学会第7回年回